

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2007年9月7日 (07.09.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/099670 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 65/38 (2006.01) C08G 59/24 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/321840
- (22) 国際出願日: 2006年11月1日 (01.11.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-052537 2006年2月28日 (28.02.2006) JP
特願2006-090758 2006年3月29日 (29.03.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大日本インキ化学工業株式会社 (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1748520 東京都板橋区坂下3丁目35番58号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 有田 和郎 (ARITA, Kazuo) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通12番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP). 小椋 一郎 (OGURA, Ichirou) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通12番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP). 森永邦裕 (MORINAGA, Kunihiro) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通12番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒1048453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING PHENOLIC RESIN AND PROCESS FOR PRODUCING EPOXY RESIN

(54) 発明の名称: フェノール樹脂の製造方法、およびエポキシ樹脂の製造方法

(57) Abstract: A process for producing a phenolic resin in which a polyarylene ether having a low melt viscosity can be industrially produced by an extremely simple method without the need of a special post-treatment after polymerization or a complicated multi-stage reaction; and a process for producing an epoxy resin from a phenolic resin obtained by that process. The process for producing a phenolic resin having a polyarylene ether structure is characterized by subjecting a polyhydric aromatic compound (A) having two or more phenolic hydroxy groups per molecule to dehydrating condensation in the presence of a basic catalyst (B).

(57) 要約: 本発明は、重合後の特別な後処理や複雑な多段階反応を要することなく、極めて簡便な方法で低溶融粘度のポリアリーレンエーテルを工業的に生産することが可能なフェノール樹脂の製造方法、更に該製造方法によって得られたフェノール樹脂からエポキシ樹脂を製造する方法を提供する。本発明は、フェノール性水酸基を1分子中に2つ以上有する多価ヒドロキシ芳香族化合物 (A) を、塩基性触媒 (B) の存在下に脱水縮合反応させることを特徴とするポリアリーレンエーテル構造を有するフェノール樹脂の製造方法に関する。

WO 2007/099670 A1